(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-273998 (P2001-273998A)

(43)公開日 平成13年10月5日(2001.10.5)

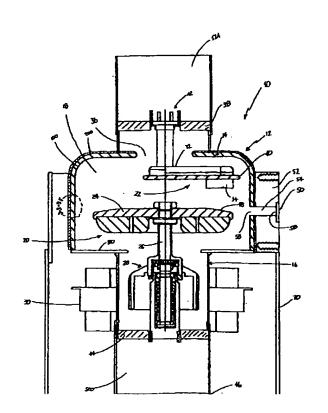
(51) Int.Cl."	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H 0 5 G 1/00		G21F 1/	08	
G21F 1/08		3/0	'00	G
3/00		G21K 5/	02	X
G21K 5/02		H01J 35/	'16	
H01J 35/16		H05G 1/	00	R
		審查請求	未請求 請求項の数27	OL (全 13 頁)
(21)出願番号	特顧2001-13412(P2001-13412)	(71)出顧人 5	500453636	
		,	パリアン・メディカル	・システムズ・イン
(22)出顧日	平成13年1月22日(2001.1.22)	コーポレーテッド		
			アメリカ合衆国カリフ	ォルニア州94304,
(31)優先権主張番号	09/491416	,	パロ・アルト,ハンセ	ン・ウェイ 3100
(32)優先日	平成12年1月26日(2000.1.26)	(72)発明者	〒 クリストファー・エイ・アーティグ	
(33)優先権主張国	米国 (US)		アメリカ合衆国ユタ州	34098, サミット・
		,	パーク,エヴァーグリ・	ーン・ドライブ
		2	235	
		(72)発明者	デボラ・エル・サーモ	ン
			アメリカ合衆国ユタ州8	34117,ホラディ,
		-	サウス・ワンダー・レ	イン 5088
		(74)代理人 1	100089705	
		j	弁理士 社本 一夫	(外5名)

(54) 【発明の名称】 X線管及びその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 アノードアセンブリ及びカソードアセンブリ 用の排気した包皮体を提供すべく単一の一体的ハウジン グを利用する、放射線写真撮影装置及びその製造方法に 関するものである。

【解決手段】一体的ハウジング12は、プラズマ溶射法により付着させた粉体金属から成る、放射線遮蔽層200を有する、コーバのような基層材料にて製造する。粉体金属は、例えば、タングステン及び鉄を含み、このため、放射線遮蔽層200が十分な放射線遮断手段及び熱伝導特性を提供し、追加的な外部ハウジングは不要である。一体的ハウジング12は空冷されるから、液体冷却削は利用しない。更に、アセンブリ10は、ハウジング上の電気的接続部を電気的に絶縁する誘電性ゲル材料を利用する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つの構成要素を有するX線 管において、

少なくとも1つの構成要素の形状にて実質的に形成され た基部基層と、

前記基部基層の少なくとも一部に付与され、X線管構成 要素を透過可能なX放射線の量を所定のレベルまで制限 する材料を含む被覆と、を備えるX線管。

【請求項2】 請求項1に記載のX線管において、前記 的な熱膨張率を有する少なくとも1つの材料から成る、 X線管。

【請求項3】 請求項1に記載のX線管において、前記 被覆がタングステンを含む、X線管。

【請求項4】 請求項3に記載のX線管において、前記 タングステンの量が重量比で被覆材料の約50%乃至約 100%の範囲にある、X線管。

【請求項5】 請求項1に記載のX線管において、前記 被覆が鉄を含む、X線管。

鉄の量が重量比で被覆材料の約1%乃至約50%の範囲 にある、X線管。

【請求項7】 請求項1に記載のX線管において、前記 基部基層がコーバ (登録商標)で形成された、X線管。 【請求項8】 請求項1に記載のX線管において、前記 基部基層が、合金46、ニッケル、銅、ステンレス鋼、 モリブデン及び前記の合金の少なくとも1つから成る、 X線管。

【請求項9】 請求項1に記載のX線管において、前記 び前記の合金の少なくとも1つから成る、X線管。

【請求項10】 請求項1に記載のX線管において、X 線管の少なくとも1つの構成要素がX線管ハウジングで ある、X線管。

【請求項11】 請求項1に記載のX線管において、前 記被覆がプラズマ溶射法を使用して前記基部基層に付与 される、X線管。

【請求項12】 請求項1に記載のX線管において、基 層材料と前記被覆との間に配置された接着層を更に備 え、該接着層が、前記基層と前記被覆との間の結合強度 40 を向上させる、X線管。

【請求項13】 X線発生装置において、

負圧包囲体を形成する一体的ハウジングと、

前記一体的ハウジングの表面の少なくとも一部に付与さ れ、該一体的ハウジングの被覆部分を透過可能なX放射 線の量を所定のレベルに制限する材料を含む被覆と、 標的部分を有する回転アノードを有し、該回転アノード が負圧チャンバ内に配置されるアノードアセンブリと、 前記負圧包囲体内に配置されると共に、前記一体的ハウ

を発生させ得るように標的部分を打撃する電子を放出す ることのできる電子発生源を有するカソードアセンブリ と、

前記X線発生装置への高電圧の電気的接続部の少なくと も一部を電気的に絶縁し得るように方向決めされた誘電 性ポリマー材料を保持する領域とを備える、X線発生装 置。

【請求項14】 請求項13に記載のX線発生装置にお いて、前記誘電性ポリマー材料が、GERTV60、 被覆が、前記基部基層の熱膨張率と実質的に同様の特徴 10 ダウコーニングのシルガード577、ダウコーニングの 絶縁性ゲル3-4154、エポキシ、ベークライト及び 熱硬化性プラスチックの少なくとも1つから成る、X線 発生装置。

> 【請求項15】 請求項13に記載のX線発生装置にお いて、前記一体的ハウジングからハウジングの外側の領 域までの熱伝導率を増す手段を更に備える、X線発生装 置。

【請求項16】 請求項15に記載のX線発生装置にお いて、前記熱伝導率を増す手段が、前記一体的ハウジン 【請求項6】 請求項5に記載のX線管において、前記 20 グの外側の少なくとも一部分に添着された複数のフィン 構造体から成る、X線発生装置。

> 【請求項17】 請求項16に記載のX線発生装置にお いて、前記一体的ハウジングの少なくとも一部分に付与 されて、該一体的ハウジングと前記複数のフィンとの間 の結合を容易にする結合被覆を更に備える、X線発生装 置。

【請求項18】 請求項13に記載のX線発生装置にお いて、窓部から出るX線が最初に、通路を自由に透過し なければならないように窓部と標的部分との間に配置さ 被覆が銅、モリブデン、タンタル、鋼、ビスマス、鉛及 30 れ且つ方向決めされたX線信号通路を更に備え、後方散 乱した電子が窓部に達するのことが防止されるような通 路の寸法であるようにした、X線発生装置。

> 【請求項19】 X線発生装置内で使用されるX線管構 成要素の製造方法において、

基層材料をX線管構成要素の形状に形成するステップ と、

基層材料の被覆部分を透過可能なX線の量を所定のレベ ルに制限する材料から成る放射線遮蔽被覆を基層上に付 着するステップとを備える、方法。

【請求項20】 請求項19に記載の方法において、被 覆を付着するステップがプラズマ溶射法により行われ る、方法。

【請求項21】 請求項19に記載の方法において、基 層と放射線遮蔽被覆との間の接着強度を向上させる結合 被覆を、基層と放射線遮蔽被覆との間に付着するステッ プを更に備える、方法。

【請求項22】 請求項21に記載の方法において、接 着被覆を付着するステップがプラズマ溶射法により行わ れる、方法。

ウジングの製造方法において、

基層金属材料をハウジングの形状に形成するステップ

接着層を基層の表面の少なくとも一部分にプラズマ溶射 するステップと、

極めて不透過性のX線吸収材料である少なくとも1つの 粉体金属から成る粉体金属材料を基層上にX線遮蔽層を 形成し得るようにププラズマ溶射するステップと、

X線遮蔽層の厚さが少なくとも約0.2159cm(約 0.085インチ)となる迄、プラズマ溶射ステップを 10 な部分(約1%の場合もある)からX線が発生される。 **続行するステップとを備える、製造方法。**

【請求項24】 請求項23に記載の製造方法におい て、基層金属材料が、コーバ、合金46、ニッケル、 銅、ステンレス鋼、モリブデン及び前記の合金の1つか ら選ばれる、製造方法。

【請求項25】 請求項23に記載の製造方法におい て、粉体金属材料が、基層金属材料の熱膨張特性と実質 的に同様の熱膨張特性を有する少なくとも1つの粉体金 属を更に含む、製造方法。

【請求項26】 請求項24に記載の製造方法におい て、熱膨張特性を有する粉体金属材料が鉄である、製造 方法。

【請求項27】 請求項23に記載の製造方法におい て、極めて不透過性のX線吸収材料である粉体金属がタ ングステンである、製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、X線発生装置、及 びその製造方法に関する。より具体的には、本発明は、 改良された熱的安定性及び改良されたX線管遮蔽特性を 30 提供する排気したハウジングアセンブリを有するX線管 に関する。本発明は、また、改良されたハウジングアセ ンブリを製造する方法にも関する。

[0002]

【従来の技術】X線発生装置は、多岐に亙る医療及び産 業的用途にて使用される極めて価値ある道具である。例 えば、かかる装置は、医療診断及び治療用放射線写真撮 影法のような分野にて一般に使用される。

【0003】関連する特定の用途に関係なく、X線装置 の基本的作用は同様である。一般に、X線発生装置に は、アノードアセンブリ及びカソードアセンブリを包み 込む負圧チャンバが形成されている。 カソードアセンブ リは、電子を放出することのできる電子放出フィラメン トを有する。アノードアセンブリは、カソードから軸方 向に隔てられ且つカソードにより放出された電子を受け 取り得るように方向決めされたアノード標的を提供す る。カソードとアノード標的との間に高電圧の電位を配 置することにより、作動時、カソードフィラメントによ り放出された電子は、アノード標的における1つの焦点 標的の焦点領域に衝突する。アノード標的は、高耐火性 金属で出来ており、このため、電子が打撃すると、発生 する運動エネルギの少なくとも一部分がX放射線すなわ ちX線を発生する。次に、X線は、負圧包囲体の壁に形 成された窓部を貫通し、患者のような標的領域に向けて 平行にされる。周知であるように、標的領域を貫通する X線を検知し且つ分析して、医療診断検査のような、多

数の用途の任意の1つに使用することができる。

【0004】一般に、X線管の入力エネルギの極く僅か 実際上、標的表面における高速度の電子の衝突に起因す る入力エネルギの大部分は、極めて高温度の熱に変換さ れる。 更に、 アノードを打撃する電子の 1%は、 標的表 面から反発し、X線管アセンブリ内の他の領域を打撃す る。これら二次的電子(「後方散乱電子」とも称される こともある)が衝突することは、熱を発生させ且つ/又 は不規則なX線を発生させることになる。この余剰な熱 は、アノードアセンブリにより吸収され且つアノードア センブリの他の部分に、及び負圧ハウジング内に配置さ 20 れた他の構成要素に伝達される。時間の経過により、こ の熱は、アノード、アノードアセンブリ及び/又はその 他の管構成要素を損傷させ、X線管の有効寿命及び/又 は管の性能及び作動効率を低下させる可能性がある。

【0005】X線管内に高温の作動温度が存在すること に起因する問題点を緩和するのに役立つ幾つかの方策が 使用されている。例えば、幾つかのX線装置において、 X線標的すなわち焦点軌道は、回転可能なアノードディ スクの環状部分上に配置される。次に、アノードディス ク(ロータリ標的又はロータリアノードと称されること もある)を支持軸及びロータのアセンブリに取り付け、 次に、そのアノードディスクを何らかの型式のモータに より回転させることができる。X線管の作動中、アノー ドディスクを高速度にて回転させ、それにより、焦点軌 道は連続的に回転して、電子ビームの経路に入ったり、 その経路外に出るようにする。このようにして、電子ビ ームは、短時間だけ、焦点軌道に沿った所定の点に接触 する。このことは、軌道が電子ビームの経路内に戻るの に必要な時間の間、軌道の他の部分が冷却するのを許容 し、これにより、アノードにより吸収される熱量を少な 40 くする。

【0006】アノードが回転する性質であることは、焦 点軌道上の焦点に存在する熱の量を少なくするが、アノ ード、アノード駆動アセンブリ、及び排気したハウジン グ内の他の構成要素には依然として多量の熱が存在す る。管(及び隣接するその他の電気的構成要素)の損傷 を防止しX線装置の効率及び全体的な有効寿命を増すた めには、この熱を連続的に除去しなければならない。

【0007】1つの方策は、排気した包皮体を形成する ハウジングを第二の外側金属製ハウジング(「缶」と称

30

ハウジングは幾つかの機能を果たさなければならない。 第一に、このハウジングは、上述した後方散乱電子に起 因するような、放射線の漏洩を防止する放射線遮蔽体と して機能しなければならない。そして、それをするに は、該缶は、放射線遮蔽体を備え、この放射線遮蔽体は 鉛のようなある型式の極めて不透過性のX線吸収性材料 にて形成しなければならない。第二に、外側ハウジング は、排気した内側ハウジングの外面の上をポンプにより 連続的に循環させることのできる、誘電性油のような冷 却媒体の容器として機能する。熱がX線管の構成要素 (アノード、アノード駆動アセンブリ等) から放出され ると、その熱は、排気したハウジングの外面に放射さ れ、次に、少なくともその一部分は冷却剤流体によって 吸収される。次に、加熱した流体は、輻射面のような何 らかの型式の熱交換装置に送られて、次に、冷却され る。次に、流体は、ポンプによって、外側ハウジングを 通じて後方に再循環され、工程は反復される。

【0008】誘電性油(又は、同様の流体)は、更なる機能を提供することもできる。例えば、油は、アノードアセンブリ及びカソードアセンブリ及び排気した内側ハ 20 ウジングと外側ハウジングとの間に存在する高電圧の電位間の電気絶縁体として作用する。この外側ハウジングは、典型的に、異なる電位、典型的に接地電位にある導電性金属材料から成っている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】この油及び同様の液体 冷却剤/誘電剤を使用することは、熱除去媒体及び電気 絶縁体の双方として又はその何れか一方として有用であ る一方、幾つかの点にて問題である。例えば、流体を使 用することは、X線発生装置の構造及び作用の複雑さを 増す。流体を使用することは、流体を保持する第二の外 側ハウジング又は缶構造体の存在を必要とする。この外 側ハウジングは、X線を遮断することのできる材料にて 製造しなければならず、また、冷却剤流体を保持すべく 排気した内側ハウジングの周りに配置するのに十分に大 きくなければならない。このことは、装置全体のコスト 及び製造の複雑さを増すことになる。また、外側ハウジ ングは、広い物理的スペースを必要とし、その結果、全 体としてより大型のX線発生装置が必要となる。同様 に、外側ハウジングに対して必要とされるスペースは、 排気した内側ハウジングが利用することのできるスペー スの程度を減少させることで、X線管内の他の構成要素 が利用できるスペースの程度を制限することとなる。例 えば、回転するとき、熱を一層良く飛散させる点にて、 より大径のアノードであることが望ましいが、回転アノ ードの寸法が制限される。

【0010】更に、外側ハウジングの構造はその他の点にて装置全体のコスト及び製造上の複雑さを増す。液体を冷却剤として使用するとき、装置には、ポンプ及びラ

は、閉じた循環系内にて、管及び流体導管系を介して相 互に接続しなければならない。また、流体は、加熱した とき膨張するため、閉じた系は、ダイヤフラム又は同様 の構造体のような、膨張手段を提供しなければならな い。この場合にも、これらの追加的な構成要素はX線装 置の構造の複雑さ及びコストを増すことになる。更に、 管は、流体の漏洩、及び流体系に起因する関連する破局 的な破損を一層受け易い。

6

【0011】また、液体冷却剤/誘電体は、効率的な騒音絶縁体として機能しない点にてその存在は有害でもある。実際上、液体が存在することは、機械的な振動を増し且つX線管の作動により放出される発生する騒音を増しがちである。この騒音は、患者や操作者にとって不快である。また、液体の存在は、スペースの制限及び効果的な電気的絶縁体の必要性のため、X線管により放出される騒音を減衰する他のより効果的な材料を利用する可能性も制限することになる。

【0012】最後に、誘電性の油材料を使用することは環境上の観点からも望ましくない。特に、油は有害であり、適正に処分しなければならない。従来技術のX線管には、冷却剤/絶縁媒質として外側ハウジング及び流体を使用することを不要とし、それに代えて、X線管の構成要素を包み込むため単一の排気したハウジングを使用するものもある。排気した単一のハウジングを使用することは、幾つかの点にて望ましい。例えば、外側ハウジングを不要にすることは、装置が必要とする構成要素の数を少なくする。その結果、よりコンパクトで、全体コストがより低廉であり、余り複雑でなく且つ製造がより容易であり、しかもより高信頼性のX線発生装置となる。特に、流体冷却剤/誘電体を不要にすることは、複雑さを軽減し且つ上述した故障の可能性のある箇所を少なくすることになる。

【0013】然し、排気した単一のハウジングを有する X線発生装置が有利であることが認識されているにも拘 らず、その実用性を制限する多数の問題点がある。例え ば、特に、高電圧の用途にて過剰な放射線がX線管から 漏洩するのを防止するため、ハウジングには鉛ライナー のようなX線吸収材料の層を設けなければならない。し かし、このことは、鉛遮蔽体をハウジングの壁に取り付けなければならないため、装置のコスト及び製造の複雑 さを増す。同様に、遮蔽体の取り付けは、管の信頼性を 低下させる可能性のある追加的な故障箇所を生ずる。例 えば、遮蔽体の層は、ハウジングの下側基層の熱膨張率 に正確に適合する熱膨張率を有しなければならず、さも なければ、材料は作動するX線管の極端な温度変化の存 在時に容易に分離する可能性がある。

【0014】更に、特に、高電圧の用途において、X線 管の遮蔽体又はライナーの使用は、物理的スペースを占 めるハウジングの壁の厚さを増し、その結果、全体とし は、より大径のアノードのようなその他のX線管の構成 要素が使用するであろうスペースの程度を制限すること になる。

【0015】更に、物質の毒性に関する環境上及び健康上の危険性のため、ライナー材料として、鉛、ベリリウムのような同様の材料を使用することは、同様に望ましくない。しかし、その他の適当な材料は極めて高価であり、また、製造中の操作が難しく且つ/又はX線管にて使用するのに満足し得る熱特性を有していない。

【0016】要約すると、従来技術のX線発生装置は、 典型的に、X線管を冷却剤で冷却し且つ過剰な放射線の 放出を防止することを含む多岐に亙る機能を提供すべく 第二の外側ハウジングを使用するものである。この外側 ハウジングは、X線発生装置のコスト及び複雑さを増 し、また、その長期間の信頼性を低下させる可能性があ る。このように、単一の一体的ハウジングを使用するこ とは好ましいが、この方策は、また、欠点もある。特 に、この方策は、望ましくない放射線の放出を防止する ため、鉛のようなX線遮蔽材料層をハウジング壁に使用 することを必要とする。このことは、装置のコスト及び 製造の複雑さを増し、その全体的な寸法を増大させ、従 って、環境及び安全上の観点からして望ましくない。

【0017】このように、当該技術分野では、熱を除去し且つ電気的絶縁体を提供することの双方又はその何れか一方のため、油又は同様の材料を保持するため外側ハウジングを使用することが不要な放射線写真撮影装置、及びその装置の製造方法が必要とされている。更に、鉛遮蔽体等を使用せずに、安全なレベルの放射線封じ込め機能を保つことのできる排気した単一のハウジングを使用する放射線発生装置を提供するならば、当該技術分野 30の1つの進歩になるであろう。

【0018】従来技術に存在する上記の問題点及び欠点 に鑑みて、本発明の1つの主要の目的は、X線管のアノ ードアセンブリ及びカソードアセンブリを保持するため 単一のハウジングを利用し、これにより、冷却剤を保持 し且つX線を遮断する追加的な外側ハウジングを不要に する、X線発生装置及びその装置の製造方法を提供する ことである。このことは部品の数及び重量を軽減し、装 置の製造をより低コストにし且つより容易にする。更 に、このことは従来から冷却剤及び絶縁体の双方として 40 又はその何れか一方として使用されている環境的に有害 で且つリサイクル困難な誘電性油又は同様の種類の流体 を不要にする。別の目的は、十分なレベルの放射線遮蔽 効果を提供することで、ハウジングからの放射線の漏洩 量を許容可能なレベルに制限する、一体的な要素として 形成された排気した単一のハウジングを提供することで ある。関連する1つの目的は、鉛等のような、X線遮蔽 材料の別個の層をハウジングにて必要とせずにこの放射 線遮蔽効果が提供されるように排気したハウジングを製

ことは製造の複雑さを軽減し、一体的ハウジングの全体の寸法を縮小し、有毒となる可能性のあるバルク材料を不要にする。本発明の実施の形態の更に別の目的は、作動熱を一体的ハウジングから対流させることでX線管を許容可能な作動温度に保つ外側冷却面を取り付けることを可能にし得るように製造することのできる一体的ハウジングを提供することである。

【0019】本発明の上記及びその他の目的、特徴並び に有利な点は、以下の説明及び特許請求の範囲から一層 10 完全に明らかとなり、又は以下に説明するように本発明 を実施することにより理解されよう。

[0020]

【課題を解決するための手段】簡単に要約すれば、本発 明の実施の形態は、X線管部品を包み込む多数のハウジ ングを不要にするX線発生装置に関するものである。そ れに代えて、本発明の実施の形態は、カソードアセンブ リ及びアノードアセンブリを保持する負圧包囲体を提供 すべく一体的装置として形成されることが好ましい排気 した単一のハウジングアセンブリを利用する。更に、一 体的ハウジングは、X線の放出を所定のレベルまで遮断 する放射線遮断層を備えている。例えば、好ましい実施 の形態において、放射線の放出は適用可能なFDA基準 により要求されるレベル以下まで減少する。好ましく は、放射線遮断層は、プラズマ溶射法によりハウジング 基層に施された粉体金属から成るようにする。粉体金属 は、十分な放射線遮断特性を提供し、また、極端な温度 変動が存在する場合でさえハウジングの基層材料に満足 し得るように接着するように選択する。この放射線遮断 層を使用することは、物理的に分離した追加的な放射線 遮蔽構造体を不要にし、このため、一体的ハウジングの 全体的な寸法を縮小する。更に、鉛等のような、かかる 構造体に一般に使用される望ましくない材料の使用も不 要となる。

【0021】その他の好ましい実施の形態において、放射線遮断層は、同様に、冷却フィンのような外部構造体を一体的ハウジングに取り付けることを許容するプラズマ溶射技術を介して、ある組成にて更に処理する。好ましくは、この結合層は外部構造体の取り付けを容易にするようにする。

【0022】好ましい実施の形態において、単一の一体的ハウジングは、負圧包囲体を形成することのできる、全体として円筒状の本体として形成される。電子を放出する放出源を有するカソードアセンブリが一体的ハウジング内に配置されている。1つの図示した実施の形態において、カソードアセンブリは、回転するアノードに形成された焦点軌道と反対側に配置され得るように支持されているが、この一体的ハウジングは静止アノードを有するX線発生装置内で使用することができる。焦点軌道は、X線が一体的ハウジングの側部に形成された窓部を

1つの好ましい実施の形態において、アノード標的と窓部との間にX線通路が配置されている。この通路は、後方を散乱した電子すなわち二次的電子が窓部領域に達し且つ過剰な熱を発生するのを防止し得るような寸法及び形状とされている。

【0023】本発明の好ましい実施の形態は、一体的ハウジングの外面に伝達された熱を除去し且つステータから放出された熱を除去する強制的な空気対流装置、又は、アノードを回転させるモータアセンブリを利用する。この前にも、このことは、誘電性油等のような冷却 10 利流体を不要にし、このため、かかる流体の使用に内在する問題点を解消する。1つの実施の形態において、一体的ハウジングの外面の上で空気を送るためにファンが使用される。好ましくは、空気流は一体的ハウジングの少なくても一部分の周りに配置された空気流競体にて送られるようにする。また、好ましい実施の形態において、一体的ハウジングはハウジングからの熱伝導を容易にする外部空気「フィン」を備えている。

【0024】本発明の現在の好ましい実施の形態は、電気的に且つ可聴騒音の双方の点にて排気したハウジングを絶縁する手段も備えている。1つの実施の形態において、ポリマーゲルのような誘電性ポリマー材料がハウジングの特定の領域に配置されている。このポリマーは2つの機能を発揮する、すなわち、このポリマーは、アノードアセンブリ及びカソードアセンブリへの高電圧接続部を電気的に絶縁することで、排気した一体的ハウジングのアーク放電及び充電を防止する。また、このポリマーは、減衰材料として作用し、アノードロータアセンブリから生ずる振動及び騒音を吸収する。患者の快適さを保ち且つ高騒音発生力がさもなければ生ずるであろう何30らかの不快さを軽減するのに役立ち得るようにする上で、騒音放出量が減少することは特に重要である。

[0025]

【発明の実施の形態】本発明の上述し且つその他の利点 並びに目的が実現されるようにするため、添付図面に図 示したその特定の実施の形態に関して、上記に簡単に記 載した本発明について以下により詳細に説明する。これ らの図面は本発明の典型的な実施の形態のみを示すもの であり、このため、その範囲を限定するものと見なすべ きではないとの理解の下、添付図面を使用して更に具体 40 的に且つ詳細に本発明について説明する。

【0026】次に、本発明の一例としての実施の形態を図示する添付図面に関して説明する。最初に、全体として参照番号12で示した単一のハウジングアセンブリを備える構造とされた、全体として参照番号10で示した、一例としてのX線管アセンブリの断面図を示す図1を参照する。現在の好ましい実施の形態において、ハウジング12は、排気した包囲体18を画成し得るように接続された第一の包皮体部分14と、第二の包皮体部分

10 れている。全体として参照番号20で示した回転アノー ドアセンブリと、全体として参照番号22で示したカソ ードアセンブリとを含む色々なX線管構成要素が負圧包 囲体18内に配置されている。 回転アノードアセンブリ 20は、軸26を介してロータアセンブリ28に回転可 能に接続されたアノード標的24を備えている。ステー タ30は、当該技術分野にて周知の方法にてアノード2 4を回転させるのに使用可能であるようにロータアセン ブリ28に近接して一体的ハウジング12の外側に配置 されている。カソードアセンブリ22は、フィラメント (図示せず)及び関係するエレクトロニクスのような電 子発生源34を支持する取り付け構造体32を備えてい る。図示した実施の形態において、ハウジング12の壁 に形成された開口部36を通じてカソードアセンブリ2 2が負圧包囲体18内に配置されている。更に、セラミ ック絶縁体38に対する負圧密シールが形成されてい る。図示した実施の形態において、カソードアセンブリ 22は電子発生源34を支持するために使用されるディ スク構造体40も備えている。好ましくは、このディス クはX線遮断材料で形成されており、また、ディスク4 0の直径は開口部36を遮蔽し得るように選択する。 【0027】カソードアセンブリ22を高電圧の外部電 源(図示せず)に接続するコネクタアセンブリ42が、 開口部36及びセラミック絶縁体38を貫通して伸びて いる。同様の方法にて、コネクタ及び関係した電線(図 示せず)がアノードアセンブリ20を高電圧の外部電源 に接続すべく第二のセラミック絶縁体46を貫通して伸 びている。周知の如く、作動中、カソードアセンブリ2 2とアノードアセンブリ20との間に高電圧の電位を発 生させるため高電圧の電源が使用される。例えば、ある 用途において、アノードアセンブリ22は約+75kV の正電圧に保たれる一方、カソードアセンブリ22は、 約-75kVの同等の負電圧に保たれる。該当する特定 の用途に依存して、その他の電圧電位も使用可能であ る。この電圧電位によりカソード34の放出源(すなわ ち、サーモニックフィラメント)から放出された電子は モリブデン又は同様の高Z材料から成る焦点軌道48に おける焦点位置にてアノード24の表面に向けて加速さ れ且つこの表面を打撃する。この衝撃の結果として発生 されたエネルギの一部は、X線の形態をしており、次

【0028】その他の方策が使用可能であるが、図示した実施の形態において、窓部50は、一体的ハウジング12に機械的に添着された取り付けブロック52内に配置されている。好ましくは、取り付けブロック50には、焦点軌道48に隣接する箇所に形成された開口部54と、窓部50に隣接する1つの開口部58とを有する

に、このX線は、アノード24に隣接する箇所にて一体

的ハウジング12の側部に形成されたX線透過性窓部5

0を通じて放出される。

12

において、ハウジング12の側壁に形成されたX線開口 部56は、窓部50により提供される開口部よりも小さ い。窓部50がアノード標的48から離れた位置に配置 されること、及び通路54の寸法がより小さいことは、 共に窓部50の温度を低下させる機能を果す。特に、作 動中、アノード標的24における焦点から後方散乱され た電子からの「二次的」電子衝突に起因して、負圧包囲 体内の温度は窓部領域内でより高温である。かかる二次 的電子すなわち後方散乱電子は不規則な角度に散乱さ れ、通路54の方向及び相対的な寸法及び窓部50まで 10 の距離のため、形成される軌跡は、その僅かな部分だけ が窓部領域に達することを許容する。これと同時に、こ の形態は焦点上の放射線、すなわち、焦点を打撃する焦 点上の電子が通路54を通り且つ窓部50から出ること に起因する放射線を許容する。現在の好ましい実施の形 態において、通路54の長さは、後方散乱された電子が 窓部50に達するのを防止する。

【0029】図1に図示した実施の形態において、強制 的空気対流によりハウジング12の表面から熱を除去す ることができる。例えば、ファン機構(図示せず)によ 20 り一体的ハウジング12の部分の外面の上方の空気流を 提供することができる。更に、この空気流はハウジング 12の少なくとも一部分の周りに配置された空気流殻体 70を介して制御することができる。 殼体70は、ポリ カーボネート又は同様の材料で製造され且つ空気流を制 御し且つ保持し得るように方向決めされることが好まし い。好ましい実施の形態において、ファンは、殼体を通 じて空気流を吸引し得るように作用可能に接続されてい る。代替的な実施の形態において、殻体70には、接地 面を設けることができ、これにより、競体は伝導性材料 30 の少なくとも一部を含むか、又は薄い板金属の層のよう な導電性材料で完全に製造してもよい。

【0030】図示した実施の形態において、一体的ハウ ジング12の第一の包皮体部分14の少なくとも一部は 放射線遮蔽体として機能する。例えば、一体的ハウジン グ12の臨界的領域は、ビームの定格パワー値にてアノ ードとカソードアセンブリとの間に150KVの電位が 保たるとき、X線発生装置から1メートルの距離にて2 OmRad/hrに等しい、FDA基準の放射線透過量 低下させることができることを要する。上述したよう に、1つの目的は、鉛又は同様の材料で出来た別個の連 蔽プレートを利用することなく、満足し得る放射線遮蔽 効果を提供することである。 更に、 1 つの目的は、 ハウ ジング12が必要とする物理的スペースを少なくし且つ アノードディスク24のようなその他のX線管の構成要 素に利用可能なスペースを最大にし得るように、ハウジ ング壁の厚さを可能な限り薄く保つことである。別個の 遮蔽体構造体はこの目的にとって有用ではない。更に、

射線保護を実現するため、負圧包囲体の頂部壁及び側壁 の厚さを約3. 429 cm (約1. 35インチ) とする 必要があり、その結果、遥かに大型のハウジング12と なる。これと代替的に、固体モリブデンのような材料の みを使用するならば、約1.4732cm(約0.58 インチ) の厚さが必要となる。しかし、モリブデンは高 価であるため、禁止的なほどに高価なハウジングとな る。本発明の実施の形態は、上記及びその他の設計上の 問題点を課題とするものである。

【0031】特に、本発明の好ましい実施の形態は、所 望のX線遮断機能を実現するX線遮断媒体にて被覆され た基層材料で製造したハウジング12を利用する。 好ま しい実施の形態において、この基層はX線遮断被覆と共 に、又、著しく薄くしたハウジングの肉厚にて且つモリ ブデンのような高コストの遮蔽材料と比較して比較的経 済的な方法にて、十分なレベルの放射線遮蔽効果を提供 する。更に、この方策は、鉛及びベリリウムのような環 境的に毒性で且つ健康上問題のある遮蔽材料を不要にす る仕方にて実現することができる。

【0032】本発明の現在の好ましい実施の形態におい て、第一の包皮体部分14のようなハウジング12の少 なくとも一部は、基層のハウジング部分100から成っ ている。基層100は、任意の適当な製造方法を使用し て、図2に図示するような第一の包皮体部分の所望の形 状に形成される。

【0033】基層のハウジング部分100を形成するた めに使用される材料は一体的ハウジング12に対し負圧 の完全性を提供し得るように実質的に無孔であり、ま た、材料間の熱的不一致に起因する、割れ、剥がれ又は 同様の型式の障害を回避し得るように放射線遮蔽被覆 (以下に説明) の熱膨張率と実質的に同様の熱膨張率を 有するものである必要がある。更に、基層部分100に 使用される材料は、一体的ハウジングがアノードアセン ブリから放散された熱の熱リザーバとして機能するのを 許容すると共に、アノードアセンブリから熱を伝導して 除去することのできる十分な熱容量を有する必要があ る。現在の好ましい実施の形態において、基層部分は、 商業的に入手可能な材料であるコーバ(Kovar) (登録商標名) にて形成されている。その他の可能な材 の5分の1といったような予め規定した安全レベルまで 40 料は、非限定的に、合金46(ニッケルと鉄の合金)、 ニッケル、銅、ステンレス鋼、モリブデン、上記の合金 及び同様の性質を有するその他の材料を含む。1つの好 ましい実施の形態において、コーバのハウジング部分1 00は、約0.127cm(約0.05インチ)の肉厚 となるように形成されるが、関係する特定のX線発生装 置の用途に依存して、その他の厚さも使用可能である。 【0034】基層材料が所望の形状の基層ハウジング部 分100に形成されると、1つの好ましい実施の形態に

おいて、基層ハウジングは、X線管の排気した環境を汚

30

妨害するすることの双方又はその何れか一方の原因とな る全ての表面不純物を除去し得るよう清浄にする。例え ば、基層ハウジング100は、アルミニウム酸化物のよ うな適当な材料で310.264kPa (45psi) にてサンダブラストを行い、次に、ダイナデット(Dy nadet) (登録商標名) 及び塩酸溶液の双方又はそ の何れか一方のような適当な洗浄溶液で脱脂することが できる。

【0035】X線管の形態に依存して、基層ハウジング 100の外面にその後にろう付けされる追加的な成分を 使用することができる。 このように、 現在の1つの好ま しい実施の形態において、基層ハウジング100の表面 の少なくとも一部分は、その他の構造体をハウジング1 00の外面にろう付けし又は溶接する容易さを向上させ るようにニッケルのような適当な材料でめっきすること ができる。1つの実施の形態において、このろう付け促 進ニッケル層は、厚さが約0.01016乃至0.01 524mm (約400乃至600マイクロインチ) であ り、適当なめっき方法により施工される。例えば、適当 なめっき層となるように25分間、28アンペアを使用 20 することができる。

【0036】好ましい実施の形態において、ろう付け促 進層が施工されると、サンドブラスト及び超音波洗浄の ような任意の適当な洗浄方法にて基層ハウジング100 を再度清浄にして、不純物を除去する。

【0037】好ましい実施の形態において、次に、下側 基層に対し放射線遮蔽層を付与する。この材料は、基層 の被覆として付与することのできる金属組成物から成っ ており、好ましい実施の形態において、従来のプラズマ 被覆又は溶射技術により付与することのできる粉体金属 から成っている。一般に、所望の材料の特性は、所定の レベルの放射線遮蔽効果を提供し、また、形成される層 の厚さが最小であるようにする。更に、粉体金属が下側 基層の熱膨張率と正確に適合する熱膨張率を有すること で、X線発生装置の加熱及び冷却中、放射線遮蔽層の亀 裂、剥離すなわち基層からの分離を少なくすることが好 ましい。

【0038】非限定的な一例として、上記の特性を有す る現在の好ましい1つの粉体金属は、タングステン及び 鉄合金の組み合わせであり、この各々は粉体の形態にあ り、次に、粉体の組み合わせ体を提供し得るように共に 混合する。1つの好ましい実施の形態において、この組 み合わせ体は、重量比で約10%の鉄と、重量比で約9 0%のタングステンから成る。しかし、2つの金属を異 なる比率にて使用することができる、例えば、鉄の比率 を0乃至50%とすることができることが理解されよ う。この特別な混合体において、タングステン成分は必 須の放射線遮蔽特性を提供する。従って、使用されるタ ングステンの量は、層に溶射することで提供される放射

量は必要な層の厚さを決定する。図示した実施の形態に おいて、鉄成分は混合体に対し下側のコーバ基層材料と のより優れた熱的釣り合いを提供し、これにより、特

に、存在する熱条件を考慮して、放射線遮蔽層と基層と の一層優れた結合を保証する。

14

【0039】好ましい鉄及びタングステンの粉体混合体 の代替例として、他の組成成分を使用してもよいことが 理解されよう。例えば、タングステンに代えて、放射線 遮蔽効果を発揮することのできるその他の極めて不透過 性のX線吸収材料を使用することができ、この材料は、 非限定的に、色々なタングステン合金(例えば、デンシ メット、重金属合金)、銅、モリブデン、タンタル、 鋼、ビスマス、鉛及び上記の各々の合金を含む。勿論、 異なる金属の使用は一長一短がある。例えば、あるもの は、必須の放射線遮蔽レベルを提供し得るように基層上 により厚い遮蔽層を必要とする。更に、異なる金属粉体 の混合体の使用は、使用される基層材料の特別な型式に より決まる。

【0040】同様に、望まれる特別な特徴に依存して、 鉄に代えてその他の成分を使用することができる。例え ば、満足し得る置換物は、非限定的に、銅、ニッケル、 コバルト、アルミニウム等を含む。この場合にも、具体 的な選択は具体的な設計の目的に依存する。例えば、適 正な熱膨張率の適合を実現し得るように使用される基層 の種類に依存して、1つの金属を選ぶことができる。ま た、金属は、粉体金属混合体の他の成分との合金とする ことができるものであることを要する。

【0041】放射線遮蔽層200の現在の好ましい実施 の形態が図3の更なる詳細図である、図1の線3-3の 断面図に示してある。図3は、1つの実施の形態におい て、放射線遮蔽層200がプラズマ溶射技術(以下に更 に詳細に説明)によりハウジング基層100に付与され る金属粉体層202から形成される方法を示す。更に、 1つの好ましい実施の形態において、参照番号204で 示した接着剤すなわち第一の結合層は、基層100(又 は使用されるならば、ニッケルめっき層)と金属粉体層 202との間に付与される。この層は、基層100と溶 射した金属粉体層202とが一層良く結合するのを促進 する働きをする。好ましくは、結合層202は、基層1 00と金属202との間に機械的に柔軟な層を提供する 粗面とした面から成るようにする。例えば、現在の好ま しい実施の形態において、結合層202は、プラズマ溶 射方法により付与されるメトコ (Metco) 451 (セルザーメトコ (Sulzer Metco)から入 手可能) 等として公知である。この層は、例えば、基層 表面の機械的又は化学的エッチングを含む、その他の技 術により提供してもよいことが理解されよう。

【0042】第一の結合層204に加えて、現在の好ま しい実施の形態は、図3に参照番号206で示した第二 るように、幾つかの実施の形態において、冷却フィンのような外部構造体が一体的ハウジング12の表面にろう付けされる。この第二の結合層206は、X線遮蔽層202とかかる外部構造体の任意のものとの間の結合を容易にし得るように設けられる。更に、この層にて使用される材料はその結合を容易にする特性を有することが好ましい。例えば、ハウジング12への銅のろう付けを容易にするため、第二の結合層206は、銅又は銅合金材料の薄い層から成るものであることが好ましい。この場合にも、この層はプラズマ溶射法により施工することが10できる。

【0043】上述したように、現在の好ましい実施の形態において、放射線遮蔽層202、第一の結合層204及び第二の結合層206は、プラズマ被覆又は溶射法により施工されることが好ましい。1つの実施の形態において、使用されるプラズマ溶射技術は、雰囲気プラズマ溶射(APS)装置である。また、低圧プラズマ溶射法、高速度酸素燃料溶射法、プラズマジェット法を含む、その他のプラズマ溶射方法を使用することもできる。

【0044】非限定的な一例として、放射線遮蔽層20 0を付与する現在の1つの好ましい方法について以下に 説明する。最初に、1つの実施の形態において、タング ステン及び鉄の混合体である適正な粉体金属組成物を作 製する。タングステン粉体及び鉄粉体を適正な量にて混 合し(例えば、鉄粉体0.5Kg及びタングステン粉体 4.5Kg)、完全に混合し得るように30分間、回転 させる。次に、この混合体は、例えば、500℃にて3 時間、負圧下にて加熱する。

【0045】粉体金属混合体が作製されたならば、現在 30 の好ましい実施の形態において、次のステップは、第一の結合層をプラズマ溶射装置により作製した基層ハウジング100に付与することである。理解し得るように、これは、基層100と粉体金属層202との接着を容易にする層を提供する任意の適当な基層とすることができる。この適正な金属材料はプラズマ溶射ガン(又は同等の装置)に供給し、次に、基層ハウジング100の適正な表面に付与する。周知の如く、プラズマ溶射技術は、アーク及びそれに伴う高温プラズマを発生させるために反応性ガス及び印加された電圧を利用する。粉体混合体 40 をプラズマ内に噴射し、次に、空気により圧力下にて押し出し、ハウジング100の表面に向けて加速する。次に、溶融した金属はハウジング100の表面に「付着する」。

【0046】第一の結合層204が付与されたならば、次に、同様の方法にて放射線遮蔽粉体混合体を付与する。好ましい実施の形態において、これはタングステン及び鉄の混合体である。1つの好ましい方法において、タングステン及び鉄から成る放射線遮蔽層は、所望の厚

る。更に、好ましい方法において、各層を施工する間にハウジング100は、650℃の湿潤水素のような適正な設定状態にあるプッシャー加熱炉へ投入する。理解し得るように、最終的な放射線遮蔽層の厚さは、使用される特定の材料及び所望の遮蔽程度に依存する。例えば、タングステン粉体を使用するとき、0.2159cm(0.085インチ)程度であっても、安全な遮蔽効果が得られることが分かった。タングステン及び鉄粉体の混合体を使用する1つの好ましい実施の形態において、約0.4445乃至0.5207cm(約0.175乃至0.205インチ)の層(第一の結合層204を含

16

【0047】実際には、粉体金属材料を基層100にプラズマ溶射したとき、形成される層は、典型的に、重量比で同一の比率の開始材料を含まない。例えば、僅かなパーセントのタングステンが基層表面に恒久的に接着しない。

む) が実現される。

【0048】連蔽層202が付与されると、必要であれば、第二の結合層206を付与する。この場合にも、この層をプラズマ溶射法により付与することが好ましく、使用される材料は、その後にハウジング12に取り付けられる要素の組成に依存する。例えば、1つの好ましい実施の形態において、銅製の空気流フィン(以下の図4参照)がハウジング12の本体からの熱の除去を容易にし得るように表面にろう付けされている。従って、第二の結合層206は粉体銅材料のプラズマ溶射層にて形成される。

【0049】放射線遮蔽層200の全体を基層100に付与したならば、1つの好ましい実施の形態において、ハウジング12は、適正な温度、すなわち好ましい実施の形態において、650℃湿潤水素温度のプッシャー加熱炉内を移動させる。次に、ハウジング12を、5分間、超音波洗浄する。

【0050】次に、一体的ハウジング12の第一の包皮体部分14を現在の好ましい実施の形態を示す図4を参照する。一体的ハウジング12は、上述した方法にて付与された放射線遮蔽層200を備えており、このため、この層はX線発生装置の作動中、ハウジング12から漏洩しないように放射線を遮断することができる。理解し得るように、一体的ハウジング12により提供される別の機能は、作動中に発生された熱を吸収し且つその熱をアノードアセンブリ20からハウジング12の外部の箇所まで熱伝導して除去することである。具体的なX線管の用途に依存して、一体的ハウジングの包囲体の外部領域への熱伝導率を増す手段を含むことができる。図4には、一体的ハウジング12の外周に配置された複数のフィン400である、この機能を発揮する構造体の1つの例が

図示されている。フィン400は、ハウジング12の外

2から隣接する空気に伝導することのできる熱の有効率 を増し得るような寸法及び方向に設定されている。ま た、幾つかの実施の形態は、熱の除去を更に増し得るよ うにフィン400の表面に亙って強制的空気対流を提供 するファン (図示せず) 又はその他の形態の強制空気装 置を含むことができる。図示した実施の形態において、 フィンは銅材料から成り且つ一体的ハウジング12の外 面にろう付けされている。上述したように、同様に、銅 から成る第二の外側結合層206はハウジング12と銅 フィン400との結合を促進する。図示したフィンの1 つの代替例として、当業者に明らかであるように、熱を 除去するためその他の形態の構造体形を一体的ハウジン グ内に添着してもよいことが理解されよう。

【0051】上記の放射線遮蔽体200及び施工方法 は、図示した一体的ハウジング12に関して説明した が、この型式の放射線遮蔽は、任意のハウジングの形態 及び形状と関連して使用することができ、また、X線の 遮蔽を必要とする任意のX線管構成要素に関連して使用 することが可能であることも理解されよう。例えば、図 1において、カソード34を支持するディスク40はX 20 線が開口部36から出るのを遮断する機能を果たすこと ができる。堅固な鉛片又は同様のX線不透過性の材料を 配置することに代えて、上述した方法にてディスク40 は放射線遮蔽体200を有するように製造することがで きる。カソードアセンブリ22と反対側部のアノード2 4の側部により形成されたアノードプレート80の表面 に、同様の遮蔽体を配置することができる。この場合に も、この型式の放射線遮蔽を使用する結果、全体寸法が より小さく、これにより、ハウジング12内の構成要素 のスペースをより自由にする構成要素が得られる。かか る遮蔽技術は、X線発生装置のその他の分野でも同様に 使用することができる。

【0052】図5には、本発明の一体的ハウジングの1 つの実施の形態を利用するX線管の環境の別の実施の形 態が参照番号500で示してある。一体的ハウジングは 参照番号12~で示してある。ハウジング12~は、上 記の説明に従って製造された放射線遮蔽体200と、ハ ウジング12の外周の周りに形成された熱放散フィン5 02とをも備えている。この装置は、図1に関して上述 窓部504とを更に備えている。

【0053】図5には、本発明の現在の好ましい実施の 形態が利用する追加的な要素も図示されている。特に、 特定のエレクトロニクスを使用してアノードアセンブリ 及びカソードアセンブリを外部の電圧源(図示せず)に 接続する方法の一例が図示されている。例えば、露出し た線512と共に、アノードアセンブリ(ハウジング1 2 内に配置) を+75KV (例えば) に接続するため の高電圧のコネクタアセンブリ510が図示されてい

カソードアセンブリ(ハウジング12 内に配置)を一 75KVの供給電圧に接続する高電圧のコネクタアセン ブリ514が図示されている。説明したように、この実 施の形態は、単一の一体的ハウジング12~を利用し、 従って、上記のコネクタ及び線を接地電位(例えば、点 A) にあるハウジングの他の部分から電気的に絶縁する ための誘電性油は存在しない。従って、何ら絶縁体が存 在しないならば、アセンブリは電気アーク放電等を生ず るであろう。

18

【0054】この実施の形態において、このことは、参 10 照番号520、524で示した露出したエレクトロニク スを保持するリザーバ内に誘電性ゲル材料を配置し、管 の高電圧絶縁体の周りに直接的に配置されるようにする ことによって対処する。このゲルは、電圧差の大きい部 品である部品から接地電位にあるアセンブリの部分を電 気的に絶縁する手段を提供する。

【0055】全体として、好ましいゲルは、誘電性でな ければならず、また、亀裂を生じ又は分離することな く、例えば、0℃乃至200℃の範囲の温度サイクルに 抵抗し得るものであることが好ましい。現在の好ましい ポリマー材料は、GE、RTV60、ダウコーニング、 シルガード577、ダウコーニング、絶縁ゲル3-41 54、エポキシ、ベークライト、熱硬化性プラスチック を含む。エポキシ又は熱硬化性プラスチックの1つの利 点は、外部の保持構造体を必要としない点である。これ ら型式のゲルを使用する別の利点は、これらゲルがX線 管の作動騒音を減少させる機能を果たす点である。

【0056】要するに、上述したX線管アセンブリは、 従来技術で従来見られなかった各種の利点をもたらす。 放射線遮蔽層を有する上述した一体的ハウジングを利用 30 する管アセンブリは、第二の外側ハウジングを不要に し、又、流体冷却剤冷却装置及び流体誘電体の双方又は その何れか一方を不要にする。更に、一体的ハウジング は十分な放射線遮断効果を提供し、又、鉛めっき又は環 境及び安全にとって危険性のあるその他の同様の材料を 使用せずに、この効果が可能である。更に、最小の厚さ の壁を有するハウジングとなるような仕方にて放射線連 蔽層を付与するその結果、寸法的により小さい外側ハウ ジング構造体となる。その結果、より狭い空間内で製造 したものと同様の窓部取り付けブロック506と、X線 40 することができ、また、例えば、X線管の熱性能を更に 向上させる、より大型の回転アノードディスクを利用す ることができる単一のX線管の一体的ハウジングとな る。更に、該アセンブリは、一体的ハウジングを電気的 に絶縁すると共に、作動中に放出される騒音を大幅に軽 減する特徴的な誘電性ゲルを利用する。

> 【0057】本発明は、その精神又は必須の特徴から逸 脱せずに、その他の特定な形態にて具体化することがで きる。上述した実施の形態は、全ての点にて単に一例に しか過ぎず且つ限定的なものではないと見なすべきであ

特許請求の範囲から判断されるべきである。特計請求の 範囲の意義及び均等例に属する全ての変更は、本発明の その範囲に包含されるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の排気したハウジングの現在の1つの好ましい実施の形態を具体化するX線発生装置の断面図である。

【図2】一体的ハウジングの基層部分の1つの好ましい 実施の形態の斜視図である。

【図3】放射線遮蔽層の現在の1つの好ましい形態を更 10 56 X線開口部 に詳細に示す、図1の線3-3に沿った分解断面図であ 70 空気流殻体 る。 -ト

【図4】その上に配置されたフィンを有する一体的ハウ ジングの1つの実施の形態を示す斜視図である。

【図5】現在のその他の好ましい実施の形態を具体化するX線発生装置の別の実施の形態を示す側面図である。

【符号の説明】

10	X線管アセンブリ	12	一体的ハウジ			
ングアセンブリ						
14	第一の包皮体部分	16	第二の包皮体			
部分						
18	負圧包囲体	20	回転アノード			
アセン	/ブリ					
22	カソードアセンブリ	24	アノード標的			
26	軸	28	ロータアセン			
ブリ						
30	ステータ	32	取り付け構造			

体

34 電子発生源36 開口部38 セラミック絶縁体40 ディスク構造体42 コネクタアセンブリ 46 第二のセラミック絶縁体48 焦点軌道50 X線透過性窓

20

52 取り付けブロック54 開口部/通路56 X線開口部58 開口部70 空気流殻体80 アノードプレ

ート 100 ハウジング基層 200 放射線遮蔽 層

202 金属粉体層/結合層 204 接着剤/第 一の結合層

206 第二の結合層400 フィン500 X線管の環境12 一体的ハウジング

20502熱放散フィン504X線窓部506取り付けブロック510高電圧コネ

クタアセンブリ 512 線

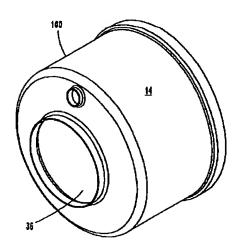
512 線 514 コネクタア

センブリ

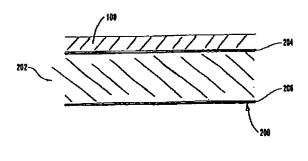
520、524 エレクトロニクス

A 接地電位

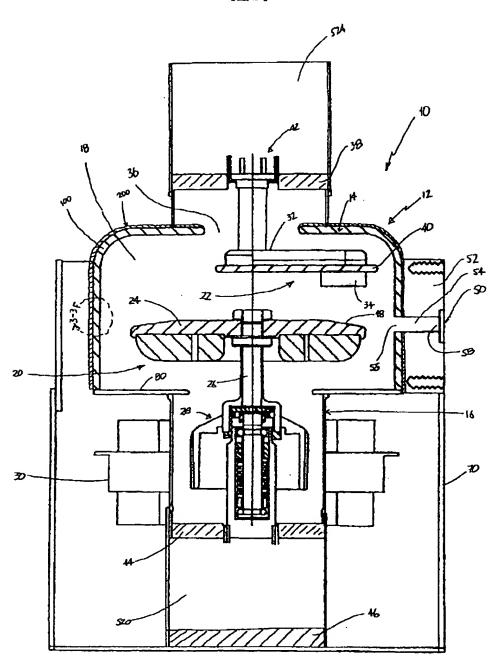
【図2】



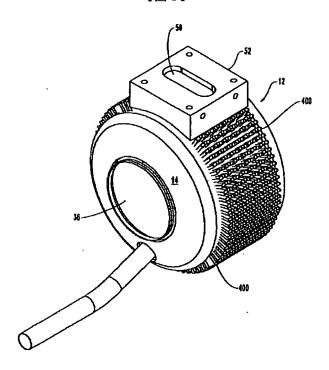
【図3】



【図1】



【図4】



【図5】

